

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成18年8月31日(2006.8.31)

【公開番号】特開2003-203560(P2003-203560A)

【公開日】平成15年7月18日(2003.7.18)

【出願番号】特願2002-291916(P2002-291916)

【国際特許分類】

H 01 J	9/02	(2006.01)
H 01 J	29/04	(2006.01)
H 01 J	31/12	(2006.01)

【F I】

H 01 J	9/02	E
H 01 J	29/04	
H 01 J	31/12	C

【手続補正書】

【提出日】平成18年7月14日(2006.7.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】電子源の製造方法であって、

基体上に、各々が一対の電極と該電極間を接続する高分子膜とからなる複数のユニットと、該各ユニットの電極に接続された配線とを配置する工程と、

前記複数のユニットの各々を構成する前記高分子膜を、全て、低抵抗化し、炭素を主成分とする導電性膜にせしめる第1の工程と、

前記炭素を主成分とする導電性膜に、前記配線を介して電圧を印加することにより前記炭素を主成分とする導電性膜の一部に間隙を形成する第2の工程とを有し、

前記第2の工程は、前記第1の工程の後に行われることを特徴とする電子源の製造方法。

【請求項2】前記第1の工程が、前記高分子膜に電子ビーム、光またはイオンビームを照射する工程により行われることを特徴とする請求項1に記載の電子源の製造方法。

【請求項3】前記各ユニットの電極に接続された配線を、行方向配線、列方向配線からなるマトリクス配線で構成することを特徴とする請求項1または2に記載の電子源の製造方法。

【請求項4】前記第2の工程は、各行方向配線または各列方向配線に結線された各ユニットに対して順次行なわれることを特徴とする請求項3に記載の電子源の製造方法。

【請求項5】前記第2の工程は、前記行方向配線と前記列方向配線のうちいずれか一方の配線群の全てに電位V1を印加し、他方の配線群のうち一部の配線にV1とは異なる電位V2を印加し、残りの配線にV1を印加する工程を有することを特徴とする請求項3または4に記載の電子源の製造方法。

【請求項6】前記第2の工程は、前記行方向配線うち一部の配線に電位V1を印加し、残りの配線にV1とは異なるV2を印加し、前記列方向配線のうち一部の配線に電位V1を印加し、残りの配線にV1とは異なるV2を印加する工程を有することを特徴とする請求項3または4に記載の電子源の製造方法。

【請求項7】前記第2の工程は、前記配線に接触配置された電気的接続手段からの通電により行われる工程を有することを特徴とする請求項1乃至4のいずれか一項に記載

の電子源の製造方法。

【請求項 8】 基体上に配置された複数の電子放出素子を有する電子源と、該電子源からの電子線の照射により画像を形成する画像形成部材とを有する画像形成装置の製造方法において、前記電子源を請求項 1 乃至 7 のいずれか一項に記載の製造方法にて製造することを特徴とする画像形成装置の製造方法。